(19)日本国特許庁 (JP)

م المعالم

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-354836 (P2001-354836A)

(43)公開日 平成13年12月25日(2001.12.25)

(51) Int.CL'	微別記号	F I 7-73-1*(参考)	)
C08L	63/00	C08L 63/00 C 4J002	
C 0 8 G	59/24	C08G 59/24 4J036	
C08K	3/36	C 0 8 K 3/36	
	5/5399	5/5399	
C08L	21/00	C 0 8 L 21/00	
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 16 ]	頁)
(21)出願番号	<b>特顧2000−177676(P2000−177676)</b>	(71) 出願人 000000387	
		旭電化工業株式会社	
(22)出廣日	平成12年6月14日(2000.6.14)	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号	
		(72)発明者 斎藤 誠一	
		東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 加	電
		化工業株式会社内	
		(72)発明者 森 貴裕	
		東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 加	電
		化工業株式会社内	
		(74) 代理人 100076532	
		弁理士 羽鳥 修	
		最終質に	रेटी .

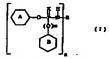
最終質に続く

## (54) 【発明の名称】 難燃性エポキシ樹脂組成物

# (57)【要約】

【課題】 ハロゲンを含まずに良好な難燃性を示すと共 に、機械強度等に優れたエポキシ樹脂組成物を提供す る。

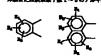
【解決手段】 下記一般式(I)で表されるリン酸アミド化合物を添加された難燃性エポキシ樹脂組成物。 【化1】

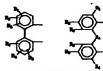


DOR. MARKEBUSANDE



(3」、3」及びを。社会や独立に水道原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルボニ ル本章をは資本原子会(~5のアルキル基を会す)を表すか、組み合わされて





(R1、R1表び21位各中株立に水泉原子、ヒドロキシ茶、ヒドロキシカルボニ ル基又は別様原子像1-48のアルキル巻、R1は泉原子像1~4のアルキリ アン基を食けりを食い、又は泉水原子又は魚水原子を、四はり又は1を、立は1 ~3の味。Rは1億アミノ巻を1億又は1億年でも落正びメラミンを除く1巻 アミノ基を1節付する基の別語を食け)

## 【特許請求の範囲】

\* ド化合物を添加された難燃性エポキシ樹脂組成物。

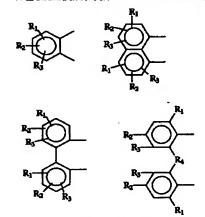
【化1】 【請求項1】 下記一般式(1)で表されるリン酸アミ\*

1

〔式中、森A及び森Bは各々独立に



 $(R_1, R_2$ 及び $R_2$ は各々独立に水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルポニ ル基または炭素原子数1~5のアルキル基を表す)を表すか、組み合わされて



(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>及びR<sub>3</sub>は各々独立に水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルポニ ル基又は炭素原子数1~5のアルキル基を、R<sub>4</sub>は炭素原子数1~4のアルキリ デン基を表す)を表し、Xは酸素原子又は硫黄原子を、mは0又は1を、nは1 ~3の数を、Rは1級アミノ基を1個又は2個有する基及びメラミンを除く1級 アミノ基を3個有する基の残基を表す)

【請求項2】 上記リン酸アミド化合物が下記一般式

※ポキシ樹脂組成物。

[化2]

(II) で表される化合物である請求項1記載の難燃性エ※

(式中、R, R, 及びR, は各々独立に水素原子、ヒ 40 は環の縮合を、1は0又は1の数を表す) ドロキシ基、ヒドロキシカルボニル基又は炭素原子数1 ~5のアルキル基を、R、及びR。は各々独立に直接結 合又は炭素原子数1~4のアルキレン基を、Zは直接結 合、酸素原子、硫黄原子、スルホニル基、エステル結 合、アミド結合、炭素原子数1~4のアルキリデン基又

【請求項3】 上記リン酸アミド化合物が下記化合物 (III) である請求項2記載の難燃性エポキシ樹脂組成

【化3】

【請求項4】 エポキシ樹脂が下記一般式(IV)で示される化合物を含む請求項1、2又は3記載の難燃性エポキシ樹脂組成物。

#### (化4)

(式中、Yは炭素原子数1~8のアルキレン基又はアルキリデン基を表す)

【請求項5】 シリカ、ゴム、フェノールノボラック型 硬化剤を添加された請求項1記載の難燃性エポキシ樹脂 組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反応性リン酸アミ 20 ド化合物により難燃化されたエポキシ樹脂組成物に関す る。

#### [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、世界的な環境問題、人体に対する安全性についての関心の高まりと共に、エポキシ樹脂製品については、難燃性に加えて、より少ない有害性、より高い安全性という要求が増大している。すなわち、エポキシ樹脂製品は、単に燃えにくいだけでなく、有害性ガスや発煙の発生が少ないことが要望されている。従来、注型品、塗料、接着 30 剤、ブリント基板等に用いられるエポキシ樹脂の難燃化方法として、難燃剤として作用する臭素を含有する臭素化エポキシ樹脂、特にテトラブロモビスフェノールA型エポキシ樹脂が一般に使用されている。

【0003】このような臭素化エポキシ樹脂は、良好な 難燃性を有するものの、燃焼時に有害なハロゲン化水素 (臭化水素)ガスを発生するため、その使用が抑制され つつある。そのため、通常のエポキシ樹脂に非ハロゲン 系難燃剤、例えば、窒素化合物、リン化合物、無機化合 物等を配合した組成物が開発されている。しかしなが ら、これら難燃付与性添加剤は、エポキシ樹脂の硬化に 悪影響を及ぼしたり、硬化組成物の耐湿性を低下させる 等の問題がある。

【0004】例えば、特開平10-195178号公報 10 には、反応性のリン酸エステル化合物を用いることが提 案されているが、リン酸エステルが樹脂中に組み込まれ ると吸湿し易くなったり、一部が3次元構造になってエ ボキシ樹脂の粘度が増大し、作業性が大きく低下するた め、実用的ではなかった。

【0005】また、特開平8-12692号公報には、メラミンのリン酸アミド化合物が難燃剤として有用であることが提案されている。しかし、エポキシ樹脂においては架橋剤として機能し、得られる硬化物は柔軟性に乏しい問題があった。

) 【0006】さらに、特開平10-175985号公報 には、非反応性のリン酸アミド化合物が提案されてい る。この化合物は非反応性であり、低分子量物が樹脂中 に存在することで樹脂物性を低下させる。

【0007】その他、特開平6-212067号公報には、ホスホン酸アミドが提案されている。しかし、ボリエステル樹脂用難燃剤としての提案であり、それ自身が高分子量であること等もあり、エボキシ樹脂の難燃剤としては性能が不足していた。

【0008】従って、本発明は、上記の欠点を解消する ためになされたもので、ハロゲンを含まずに良好な難燃 性を示すとともに、機械強度等に優れたエポキシ樹脂組 成物を提供することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の現 状に鑑み鋭意研究を重ねた結果、後述する組成物が上記 の目的を達成することを見い出し、本発明を完成したも のである。

【0010】即ち、本発明は、第一に、下記一般式

(I)で表されるリン酸アミド化合物を添加された難燃 40 性エポキシ樹脂組成物を提供するものである。

【化5】

〔式中、葉A及び葉Bは各々独立に



(R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>及びR<sub>2</sub>は各々独立に水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルポニ ル基または炭素原子数1~5のアルキル基を表す)を表すか、組み合わされて

 $(R_1, R_2$ 及び $R_3$ 社各々独立に水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルポニ ル基又は炭素原子数  $1 \sim 5$  のアルキル基を、 $R_4$ は炭素原子数  $1 \sim 4$  のアルキリ デン基を表す)を表し、Xは酸素原子又は酸黄原子を、mは0又は1を、nは1 ~3の数を、Rは1級アミノ基を1個又は2個有する基及びメラミンを除く1級 アミノ基を3個有する基の残基を表す)

【0011】第二に、上記リン酸アミド化合物が下記一 般式 (II) で表される化合物である機械物性と難燃性に 優れた上記難燃性エポキシ樹脂組成物を提供するもので\*

\*ある。 【化6】

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 & R_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & H \\ P - N - R_5 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & I \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H & O \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & I \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & I \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & I \\ I \end{bmatrix}$$

(R1、R2及びR,は各々独立に水素原子、ヒドロキ アルキル基を、R、及びR。は各々独立に直接結合又は 炭素原子数1~4のアルキレン基を、Zは直接結合、酸 素原子、硫黄原子、スルホニル基、エステル結合、アミ ド結合、炭素原子数1~4のアルキリデン基又は環の縮※ ※合を、1は0又は1の数を表す)

シ基、ヒドロキシカルボニル基又は炭素原子数1~5の 40 【0012】第三に、上記リン酸アミド化合物が下記化 合物(III)である特に機械物性と難燃性に優れた上記 難燃性エポキシ樹脂組成物を提供するものである。 [化7]

(5)

【0013】第四に、エポキシ樹脂が下記一般式(IV) で示される化合物を含む高いガラス転移温度を有する上 記難燃性エポキシ樹脂組成物を提供するものである。 【化8】

(式中、Yは炭素原子数1~8のアルキレン基又はアル キリデン基を表す)

【0014】第五に、シリカ、ゴム、フェノールノボラ 10 れる化合物が挙げられる。 ック型硬化剤を添加された機械強度に優れる上記難燃性 エポキシ樹脂組成物を提供するものである。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 【0016】式(I) において、R, 、R, 、R, で表 されるアルキル基としては、メチル、エチル、プロピ ル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、 ペンチル等が挙げられる。

【0017】式(I)において、R。で表されるアルキ リデン基としては、メチレン、エチリデン、プロピリデ 20 ン、ブチリデン等が挙げられる。

【0018】式(I) において、Rで表される1級アミ ノ基を1個有する有機残基を与えるアミノ化合物として は、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン等の アルキルアミン;シクロヘキシルアミン等のシクロアル キルアミン;ベンジルアミン等のアリールアルキルアミ ン;アニリン、2、6-ジメチルアニリン等の芳香族ア ミン等が挙げられる。その他、アミノフェノール、アミ ノ安息香酸等のアミン以外のエポキシ基と反応する官能 基を有する化合物等が挙げられ、これら2官能の化合物 は硬化剤として添加できるため、配合が容易であり好ま しい。

【0019】式(1) において、Rで表される1級アミ ノ基を2個有する有機残基を与えるアミノ化合物として は、例えば、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミ ン等のアルキレンジアミン、ジェチレントリアミン、ト リエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン等の ポリアルキレンポリアミン; イソホロンジアミン、1. 3-ジアミノメチルシクロヘキサン、ビス (3-メチル -4-アミノシクロヘキシル)メタン、1-アミノ-1 40 ロヘキサン、ビス(4-アミノシクロヘキシルメタン) 等のシクロアルキル基を有する脂肪族ジアミン:ポリプ ロピレンオキサイド  $-\alpha$ , ωージアミン、1, 9 - Uス  $(3-r \le 1)^2 = (3-r \le 1)^2 =$ キサスピロウンデカン等のエーテル結合を有する脂肪族 ジアミン化合物;pーフェニレンジアミン、mーフェニ レンジアミン、ビス(4-アミノフェニル)メタン、ビ ス(4-アミノフェニル)エーテル、ピス(4-アミノ フェニル)スルホキシド、4-アミノフェニル-4'- 50

アミノフェニルアミド、2,4-ジアミノ-6-フェニ ルー1、3、5ートリアジン、2、4ージアミノー6ー メチルー1、3、5-トリアジン等の芳香族ジアミン化 合物;1,3-ビス(アミノメチル)ベンゼン、1,4 - ピス(アミノメチル)ベンゼン等の芳香環を有する脂 肪族ジアミン化合物等が挙げられる。

【0020】式(I)において、Rで表されるメラミン を除く1級アミノ基を3個有する有機残基を与えるアミ ノ化合物としては、例えば、以下の一般式(V)で表さ

[0021]

【化9】

$$\begin{bmatrix} H_2N-Z_2 & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}_3 R_5 \qquad (V)$$

(式中、Z,及びZ,は各々独立に直接結合、エーテル 結合、炭素原子数1~4のアルキレン基又はアルキレン オキシ基を、R, は3価の有機基を示す)

【0022】R、で表される3価の有機基としては、例 えば、以下の有機基が示される。

[0023]

【化10】

【0024】乙、及び乙、で表されるアルキレン基とし てはメチレン、エチレン、プロピレン、トリメチレン、 テトラメチレン等が挙げられ、アルキレンオキシ基とし ては、上記アルキレン基に対応する基が挙げられる。

【0025】上記一般式(1)で表される化合物として は、より具体的には、例えば、以下の化合物 No. 1~ 30が挙げられる。但し、本発明は以下の例示により何 ら制限されるものではない。

[0026]

【化11】

## 化合物 No.1

$$\left[ \bigcirc - o \right]_{2}^{O \quad H} - \left[ \bigcirc \right]$$

[0027]

【化12】

化合物 No.2

$$\begin{bmatrix} \bigcirc \\ \bigcirc \\ -0 \end{bmatrix}_{2}^{0} \xrightarrow{(CH_3)}^{CH_3}$$

9

[0028]

化合物 No.3

化合物 No.4

$$\begin{bmatrix} \bigcirc & \mathbf{H} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{H} & \mathbf{0} \\ \mathbf{P} - \mathbf{N} & \mathbf{COH} \end{bmatrix}$$

[0030] [化15]

化合物 No.5

10

[0031]

化合物 No.6

[0032]

[0033]

$$\left[ \bigcirc -0 \right]_{P-N}^{O} - \left[ \bigcirc -0 \right]_{P-N}^{H} - \left[ \bigcirc -0 \right]_{P-N}^{H}$$

[0034]

$$\left[\bigcirc -0\right]_{P-N}^{0} - \left[\bigcirc -0\right]_{N-P}^{H-0} \left[\bigcirc -0\right]_{2}^{H-0}$$

$$* * [\{lk 2 0 \}]$$

化合物 No.10

12

11

[0036]

\* \* 【化21】

化合物 No.11

(7)

[0037]

【化22】

化合物 No.12

化合物 No.14

$$\left[ \bigcirc -0 \right]_{2}^{0} \stackrel{H}{\underset{P-N-CH_{2}}{-}} \bigcirc -CH_{2} - \stackrel{H}{\underset{N-P}{-}} \stackrel{0}{\underset{P}{-}} \left[ O - \bigcirc \right]_{2}^{0}$$

[0040]

[化25]

化合物 No.15

$$\left[ \bigcirc O \right]_{2}^{O \atop P-N} \stackrel{H}{\longrightarrow} N \stackrel{H}{\longrightarrow} O \atop N-P} \left[ O - \bigcirc O \right]_{2}^{O \atop P-N}$$

[0042]

【化27】

[0041]

【化26】

化合物 No. 1 7

$$\begin{bmatrix} \bigcirc \\ \bigcirc \\ -0 \end{bmatrix}_{2}^{O} \xrightarrow{H} \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2} - CH - O \end{bmatrix}_{CH - CH_{2}}^{CH_{3}} \xrightarrow{H} \overset{O}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} O \\ O \end{bmatrix}_{2}^{CH_{3}}$$

☆

[0043]

化合物 No.18

[0044]

13

化合物 No.19

[0045]

【化30】

化合物 No.20

$$\left[ \bigcirc -0 \right]_{p-N-C}^{0} - N-P \left[ 0 - \bigcirc \right]_{2}^{0}$$

$$\begin{bmatrix} \bigcirc -\mathbf{0} \end{bmatrix}_{2}^{0} \xrightarrow{H} \\ \stackrel{\mathsf{H}}{\sim} -\mathbf{0} \\ \stackrel{\mathsf$$

[0047]

化合物 No.22

$$\left[ \bigcirc - \circ \right]_{2}^{0} \stackrel{H}{\overset{V}{\longrightarrow}} - \left[ \bigcirc - \bigcirc \right]_{2}^{0} \stackrel{H}{\overset{V}{\longrightarrow}} \left[ \circ - \bigcirc \right]_{2}$$

[0048]

化合物 No.23

[0049]

化合物 No.24

[0050]

化合物 No.25

(9)

[0051]

\* \* 【化36】

化合物 No.28

[0052]

※ ※ 【化37】

化合物 No.27

[0053]

[化38]

化合物 No.28

★【0055】 【化40】 化合物 No.30

30

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

t-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>

[0054]

【化39】

化合物 No.29

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

【0056】上記化合物の中で下記一般式(II)で表される化合物はエポキシ樹脂の硬化剤として任意の配合量で容易に添加可能で、難燃性と機械強度に優れるので好ましい。

[0057]

40 【化41】

(R, 、R, 及びR, は各々独立に水素原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルボニル基又は炭素原子数1~5のアルキル基を、R, 及びR。は各々独立に直接結合又は炭素原子数1~4のアルキレン基を、Zは直接結合、酸 50

素原子、硫黄原子、スルホニル基、エステル結合、アミド結合、炭素原子数1~4のアルキリデン基又は環の縮合を、1は0又は1の数を表す)

【0058】R、及びR。で表されるアルキル基として

は、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル、ブチ ル、第二ブチル、第三ブチル等が挙げられる。

【0059】 L記化合物の中で下記一般式(III)で表 される化合物は強度と柔軟性のバランスがよいので特に\* \*好ましい。 [0060] 【化42】

【0061】上記化合物の合成方法としては、例えば、 ジフェニルリン酸クロライド等のオキシ塩化リンとアミ ン化合物を反応させることにより容易に得られる。ま た、本発明における化合物を合成するに際しては、電子 部品関連に用いる場合に電気特性を維持するために吸着 剤処理、アルカリ洗浄処理、水洗処理等により塩素含有 量を低くすることが好ましい。

【0062】本発明における上記一般式(I)で表され る化合物をエポキシ樹脂に適用する方法としては、本発 明における化合物はリン酸アミドのN-H基によりエポ キシ基と反応性であり、2官能又は3官能の化合物は、 硬化剤、架橋剤として樹脂構造中に組み込まれ、1官能 の化合物は、エポキシ樹脂末端に組み込まれる他、3 価 のエポキシ化合物と反応させることでエポキシ樹脂側鎖 として組み込んでもよい。

【0063】本発明に用いられるエポキシ樹脂(多価エ ボキシ化合物)としては、芳香族エボキシ化合物、脂環 族エポキシ化合物、脂肪族エポキシ化合物等が用いられ る。芳香族エポキシ化合物としては、例えば、ハイドロ キノン、レゾルシノール、ビスフェノールA、ビスフェ ノールF、4,4'-ジヒドロキシピフェニル、ノボラ ック、テトラブロモビスフェノールA等の多価フェノー ルのグリシジルエーテル化合物が挙げられる。脂環族エ ポキシ化合物としては、少なくとも1個以上の脂環族環 を有する多価アルコールのポリグリシジルエーテル又は シクロヘキセンやシクロペンテン環含有化合物を酸化剤 でエポキシ化することによって得られるシクロヘキセン オキサイドやシクロペンテンオキサイド含有化合物が挙 ジルエーテル、3、4-エポキシシクロヘキシルメチル -3.4-エポキシシクロヘキシルカルボキシレート、 3, 4-エポキシー1-メチルシクロヘキシルー3, 4 -エポキシ-1-メチルヘキサンカルボキシレート、6 - メチル- 3、4 - エポキシシクロヘキシメチル-6-メチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレ ート、3、4ーエポキシー3ーメチルシクロヘキシルメ チルー3. 4-エポキシー3-メチルシクロヘキサンカ ルポキシレート、3,4-エポキシ-5-メチルシクロ ヘキシルメチルー3、4-エポキシ-5-メチルシクロ 50 キシ樹脂の硬化物が耐水性、軟化点で優れるので好まし

ヘキサンカルボキシレート、ビス(3,4-エボキシシ クロヘキシルメチル) アジベート、メチレンピス (3, 4-エポキシシクロヘキサン)、2,2-ビス(3,4 -エポキシシクロヘキシル) プロパン、ジシクロペンタ ジエンジェポキサイド、エチレンビス(3,4-エポキ シシクロヘキサンカルボキシレート)、エポキシヘキサ ヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタ ル酸ジー2-エチルヘキシル等が挙げられる。脂肪族エ 20 ポキシ化合物としては、脂肪族多価アルコール又はその アルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテ ル、脂肪族長鎖多塩基酸のポリグリシジルエステル、グ リシジルアクリレート又はグリシジルメタクリレートの ピニル重合により合成したホモポリマー、グリシジルア クリレート又はグリシジルメタクリレートとその他のビ ニルモノマーとのビニル重合により合成したコポリマー 等が挙げられる。代表的な化合物として、1,4-ブタ ンジオールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジ オールジグリシジルエーテル、グリセリンのトリグリシ 30 ジルエーテル、トリメチロールプロパンのトリグリシジ ルエーテル、ソルビトールのテトラグリシジルエーテ ル、ジペンタエリスリトールのヘキサグリシジルエーテ ル、ポリエチレングリコールのジグリシジルエーテル、 ポリプロピレングリコールのジグリシジルエーテル等の 多価アルコールのグリシジルエーテル、またプロピレン グリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン等の 脂肪族多価アルコールに1種又は2種以上のアルキレン オキサイドを付加することにより得られるポリエーテル ポリオールのポリグリシジルエーテル、脂肪族長鎖二塩 げられる。例えば、水素添加ビスフェノールAジグリシ 40 基酸のジグリシジルエステルが挙げられる。さらに、脂 肪族高級アルコールのモノグリシジルエーテルやフェノ ール、クレゾール、ブチルフェノール、また、これらに アルキレンオキサイドを付加することによって得られる ポリエーテルアルコールのモノグリシジルエーテル、高 級脂肪酸のグリシジルエステル、エポキシ化大豆油、エ ポキシステアリン酸オクチル、エポキシステアリン酸ブ チル、エポキシ化ポリブタジエン等が挙げられる。

【0064】上記多価エポキシ化合物のうち、以下の一 般式 (IV) で表される化合物を用いると、得られるエポ 61

[0065] [化43]

(式中、Yは炭素原子数1~4のアルキレン基又はアルキリデン基を表す)

【0066】一般式(VI)におけるYで表される炭素原子数1~4のアルキレン基としては、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン等が挙げられ、アル 10キリデン基としては、エチリデン、プロビリデン、2,2-プロビリデン、ブチリデン等が挙げられる。

【0067】エポキシ樹脂硬化剤としては、潜在性硬化剤、ポリアミン化合物、ポリフェノール化合物及びカチオン系光開始剤等が挙げられる。

【0068】潜在性硬化剤としては、ジシアンジアミド、ヒドラジド、イミダゾール化合物、アミンアダクト、スルホニウム塩、オニウム塩、ケチミン、酸無水物、三級アミン等が挙げられる。これら潜在性硬化剤は、一液型の硬化性組成物を与え、取り扱いが容易なの 20で好ましい。

【0069】酸無水物としては、例えば、フタル酸無水物、トリメリット酸無水物、ピロメリット酸無水物、テトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、マレイン酸無水物、コハク酸無水物等が挙げられる。

【0070】ポリアミン化合物としては、例えば、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン等の脂肪族ポリアミン、メンセンジアミン、イソホロンジアミン、ビス(4-アミノー3-メチルシク 30ロヘキシル)メタン、ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、3、9-ビス(3-アミノブロビル)2、4、8、10-テトラオキサスピロ[5、5]ウンデカン等の脂環族ポリアミン、m-キシレンジアミン等の芳香環を有する脂肪族アミン、m-フェニレンジアミン、2、2-ビス(4-アミノフェニル)プロバン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、α、αービス(4-アミノフェニル)-p-ジイソプロビルベンゼン等の芳香族ポリアミンが挙げられる。

【0071】ボリフェノール化合物としては、例えば、 4フェノールノボラック、 o ークレゾールノボラック、 t ーブチルフェノールノボラック、ジシクロペンタジエンクレゾール、テルペンジフェノール、テルペンジカテコール、1, 1, 3ートリス(3ー第三ブチルー4ーヒドロキシー6ーメチルフェニル)ブタン、ブチリデンビス(3ー第三ブチルー4ーヒドロキシー6ーメチルフェニル)等が挙げられる。フェノールノボラックは得られるエボキシ樹脂の電気特性、機械強度が積層板に適しているので好ましい。

【0072】本発明に使用するカチオン系光開始剤と

は、エネルギー線照射によりカチオン重合を開始させる 物質を放出させることが可能な化合物であり、特に好ま しいものは、照射によってルイス酸を放出するオニウム 塩である複塩又はその誘導体である。かかる化合物の代 表的なものとしては、下記の一般式

[A] \*\* [B] \*-

(11)

で表される陽イオンと陰イオンの塩を挙げることができる。

【0073】CCで陽イオン [A] \*\*はオニウムである のが好ましく、その構造は、例えば、下記の一般式 [(R¹³)』Q] \*\*

で表すことができる。

【0074】さらにてて、R<sup>1</sup>\*は炭素数が $1\sim60$ であり、炭素原子以外の原子をいくつ含んでもよい有機の基である。aは $1\sim5$ なる整数である。a個のR<sup>1</sup>\*は各々独立で、同一でも異なっていてもよい。また、少なくとも1つは、芳香環を有する上記の如き有機の基であることが好ましい。QはS、N、Se、Te、P、As、Sb、Bi、O、I、Br、CI、F、N=Nからなる群から選ばれる原子あるいは原子団である。また、陽イオン [A] \*・中のQの原子価をqとしたとき、m=a-qなる関係が成り立つことが必要である(但し、N=Nは原子価0として扱う)。

【0075】また、陰イオン[B] <sup>\*\*</sup>は、ハロゲン化物 錯体であるのが好ましく、その構造は、例えば、下記一 般式

[LX,] \*-

で表すことができる。

【0076】さらにここで、Lはハロゲン化物錯体の中心原子である金属又は半金属(Metalloid)であり、B、P、As、Sb、Fe、Sn、Bi、Al、Ca、In、Ti、Zn、Sc、V、Cr、Mn、Co等である。Xはハロゲン原子である。bは3~7なる整数である。また、陰イオン[B] \*-中のLの原子価をpとしたとき、m=b-pなる関係が成り立つことが必要である。

【0077】上記一般式で表される陰イオン [LXb] \*-の具体例としては、テトラフルオロボレート (BF, )-、ヘキサフルオロフォスフェート (P

40 F。) 、ヘキサフルオロアンチモネート(SbF。)
 ・ヘキサフルオロアルセネート(AsF。) 、ヘキサクロロアンチモネート(SbCl。) 等が挙げられる

【0078】また、陰イオンB\*-は、

 $[LX_{b-1} (OH)]^{\bullet-}$ 

で表される構造のものも好ましく用いることができる。 L、X、bは上記と同様である。また、その他用いることができる陰イオンとしては、過塩素酸イオン (CIO 、) -、トリフルオロメチル亜硫酸イオン (CF, SO 、) -、ト ルエンスルホン酸陰イオン、トリニトロベンゼンスルホ ン酸陰イオン等が挙げられる。

【0079】本発明では、このようなオニウム塩の中で も、下記のイ) ~ハ) の芳香族オニウム塩を使用するの が特に有効である。これらの中から、その 1 種を単独 で、又は2種以上を混合して使用することができる。

【0080】イ) フェニルジアゾニウムヘキサフルオロ ホスフェート、4-メトキシフェニルジアゾニウムヘキ サフルオロアンチモネート、4-メチルフェニルジアゾ ニウムヘキサフルオロホスフェート等のアリールジアゾ 10 ニウム塩。

【0081】ロ) ジフェニルヨードニウムヘキサフルオ ロアンチモネート、ジ (4-メチルフェニル) ヨードニ ウムヘキサフルオロホスフェート、ジ(4 – tert-ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロホスフェ ート等のジアリールヨードニウム塩。

【0082】ハ)トリフェニルスルホニウムヘキサフル オロアンチモネート、トリス(4 - メトキシフェニル) スルホニウムヘキサフルオロホスフェート、ジフェニル -4-チオフェノキシフェニルスルホニウムヘキサフル 20 オロアンチモネート、ジフェニル-4-チオフェノキシ フェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、

4, 4'-ビス(ジフェニルスルフォニオ)フェニルス ルフィド-ビス-ヘキサフルオロアンチモネート、4. 4・ -ビス(ジフェニルスルフォニオ)フェニルスルフ ィドービスーヘキサフルオロホスフェート、4,4'-ビス [ジ (β-ヒドロキシエトキシ) フェニルスルホニ オ] フェニルスルフィド-ビス-ヘキサフルオロアンチ モネート、4、4′-ビス[ジ(β-ヒドロキシエトキ シ) フェニルスルホニオ] フェニルスルフィド-ビス-ヘキサフルオロホスフェート、4-[4'-(ベンゾイ ル) フェニルチオ] フェニルージー(4-フルオロフェ ニル) スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4 - [4・- (ベンゾイル) フェニルチオ] フェニルージ - (4-フルオロフェニル) スルホニウムヘキサフルオ ロホスフェート等のトリアリールスルホニウム塩等が好 ましい。

【0083】また、その他好ましいものとしては、(ヵ 5 - 2, 4 - シクロペンタジエン - 1 - イル) ((1, 2, 3, 4, 5, 6,  $-\eta$ ) -  $(1-\lambda + \mu + \mu)$  × 40 ンゼン]-アイアン-ヘキサフルオロホスフェート等の 鉄-アレーン錯体や、トリス(アセチルアセトナト)ア ルミニウム、トリス (エチルアセトナトアセタト) アル ミニウム、トリス (サリチルアルデヒダト) アルミニウ ム等のアルミニウム錯体とトリフェニルシラノール等の シラノール類との混合物等も挙げられる。

【0084】これらの中でも実用面と光感度の観点か **ら、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩、鉄** - アレーン錯体を用いることが好ましい。

アミン系等の公知の光重合促進剤の1種又は2種以上と 組み合わせて用いても良い。光開始剤は、本発明のエポ キシ樹脂組成物中、0.1~30重量%含有していると とが好ましい。0.1重量%未満では添加効果が得られ ないことがあり、30重量%より多いと硬化物の機械強 度が低下することがある。

【0086】光開始剤を用いる場合の重合に用いる光源 としては、髙圧水銀灯、メタルハライドランプ、キセノ ンランプ等の公知の光源を用い、紫外線、電子線、X 線、放射線、高周波等の活性エネルギー線の照射により 上記光開始剤からルイス酸を放出することで、上記エポ キシ化合物を効果させる。これら光源としては、400 nm以下の波長を有する光源が有効である。

【0087】本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、難 燃性を向上するために、含窒素化合物を併用することが 好ましい。含窒素化合物としては、メラミン及びその誘 導体、シアヌル酸及びその誘導体、グアナミン及びその 誘導体等が挙げられる。但し、メラミン等の1級アミノ 基又は2級アミノ基を有する化合物はエポキシ樹脂の硬 化剤であり、多量に配合すると得られるエポキシ樹脂が 脆化する等の物性に大きく影響するのでエポキシ樹脂に 要求される物性に応じて誘導体として用いることが好ま しい。例えば、メラミン誘導体としては、フェノール化 合物とメラミン化合物とアルデヒド化合物との共縮合樹 脂として得られる分子中に窒素原子を含有するフェノー ル樹脂等が挙げられる。いうまでもなく、フェノール樹 脂は、エポキシ樹脂の硬化剤として用いることができ

【0088】本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物は、必 要に応じて他の硬化性化合物、硬化促進剤、エポキシ樹 脂以外の樹脂又はゴム、スクリーン印刷性向上剤、他の 難燃剤、難燃助剤、充填剤、溶剤等が添加される。

【0089】上記硬化促進剤としては、トリフェニルホ スフィン、ジアザビシクロウンデセン、2、4、6-ト リス (ジメチルアミノメチル) フェノール及び2 -エチ ルー4-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチ ルイミダゾール等のイミダゾール化合物が含まれる。こ れら硬化促進剤は、単独で又は2種以上組み合わせて用 いることができる。硬化促進剤は、エポキシ樹脂の硬化 を促進するに十分な少量で用いられる。

【0090】本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に用い られるゴムとしては、ブタジエンゴム、ニトリルゴム、 **ブタジエン-スチレンゴム、アクリロニトリル-ブタジ** エンゴム、アクリロニトリルーブタジエンースチレンゴ ム、エチレンープロピレンゴム等の弾性に優れた耐衝撃 性を改良する<u>ゴム</u>が、機械強度の点で好ましい。

【0091】本発明の難燃性エポキシ樹脂組成物に含ま れる無機充填剤は、エボキシ樹脂組成物に付加的な難燃 剤、耐熱性、耐湿性を付与するためのものである。これ 【0085】これらの光開始剤は安息香酸系又は第三級 50 ら充填剤には、タルク、シリカ、アルミナ、水酸化アル ミニウム、水酸化マグネシウム、ガラス繊維等が含まれ、単独で又は2種以上組み合わせて用いることができる。シリカは電気特性に優れるので、本発明のエポキシ樹脂組成物を電気用途に用いる場合には、シリカを用いることが好ましい。

23

【0092】以上述べた本発明の難燃性エポキシ樹脂組 成物は、これをプロピレングリコールモノメチルエーテ ル等の好適な有機溶媒で希釈してワニスとなし、これを ガラス不織布、ガラス織布等の多孔質ガラス基材に塗 布、含浸させ、加熱するという通常の方法によりブリブ 10 レグを製造することができる。また、このブリプレグを 複数枚重ね合わせ、その積層構造の片面又は両面に銅箔 を重ね合わせた後、これを通常の条件で加熱、加圧して ガラスエポキシ銅張積層板を得ることができる。このと き、銅箔を用いなければ、積層板が得られる。多層板 は、銅張積層板(内層板)に回路を形成し、ついで銅箔 をエッチング処理した後、内層板の少なくとも片面にプ リプレグ及び銅箔を重ね合わせ、これを例えば170 °C、40kg/cm²の圧力で90分間加熱、加圧する という通常の方法により製造することができる。さら に、プリント配線板は、銅張積層板もしくは多層板にス ルーホールを形成し、スルーホールメッキを行った後、 所定の回路を形成するという通常の方法により製造する ととができる。

[0093]

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明する。

【0094】〔合成例〕

(化合物No. 1の合成) 1, 3-ビス (アミノメチ

ル)ベンゼン136.2g(1モル)、トリエチルアミン111.3g(1.1モル)をTHF200mlに溶解し、10℃以下でジフェニルリン酸クロライド537.2(2モル)のTHF溶液1000mlを2時間で滴下した。1時間室温で反応後、加熱湿流下で3時間反応した。トルエン300mlを加え水洗によりトリエチルアミン塩酸塩を取り除き、減圧脱溶媒してエタノール300mlより再結晶して白色固体504g(収率84%)を得た。

【0095】その他の試料化合物も上記合成例と同様に して得た。

【0096】〔実施例1〕表1に記載の配合物を十分に混合し、表面処理アルミニウム板上にナイフコーターを用いて乾燥後の膜厚が30μmになるように塗布した。80℃で5分間熱乾燥した後、さらに150℃で30分間ベーキングして硬化物を得た。得られた硬化物について、ガラス転移温度(Tg)、引張強度、引張弾性率、引張伸び、UL-94に基づき難燃性を評価した。結果を表1及び表2に示す。但し、試料化合物及び比較難燃20 <u>剤</u>の配合量は溶媒を除く固形分としての配合であり、配合量は得られるエボキシ樹脂組成物のリン含有量が2.0重量%となるよう調整し、単位は全て重量部である。【0097】ガラス転移温度は、動的粘弾性法で測定した。

【0098】引張試験としては、JIS-K6911により測定した。

[0099]

【表1】

		実	施		例	
	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
工术牛沙微阳1°1	40	40	40	40	40	40
エポキシ樹脂202	20	20	20	20	20	20
DCA*3	40	40	40	40	40	40
化合物No. 3	40.0					
化合物No. 7		43.2				
化合物No. 11			44.4			
化合物No. 13				87.4		87.4
化合物No. 15					36.5	
化合物No. 6						
ノポラック 1 *4	18.8	25.9	25.8	26.1	26.2	26.1
ノポラック 2 **	18.8	25.9	25.8	26.1	26.2	26.1
溶媒**	80	80	80	80	80	80
反応触媒**	3.5	3.5	3.5	3.5	8.5	8.5
水酸化アルミニウム						15
水量化マグネシウム				Ī		15
シリカ						20
ガラス転移温度(C)	179	175	178	175	200	177
引 <b>强独</b> 性 (MPa)	85	80	80	83	90	85
引要弊性率 (GPa)	2.5	2.1	2.0	2.3	2.9	2.1
引張仲び(%)	13	15	15	1.8	10	13
<b>新松件</b>	VO	VO	Vo	VO	VO	Vo

- ◆ 1:ピスフェノールA型エポキシ樹脂
- ♥ 2 : カルボン施査性NBRのピスフェノールAジグリシジルエーテル付加機
- **48:2, 2-ビス(3, 4-エポキシシクロヘキシル) プロパン**
- #4:フェノール・ペンゼン・ホルムアルデヒド综合物 (三井化学 (株) 製:X

## LC-LL)

25

●5:フェノールノボラック (住友デュレズ (株) 集: PR-53194)

**★6:エチレングリコールプチルエーテルアセテート** 

\*7:2-エチルー4-メチルイミダゾール

[0100]

【表2】

	比	較	91	
	1-1	1-2	1-3	1-4
エポキシ機器1 * 1	40	40	40	40
エポキシ番割2・1	20	20	20	20
DCA.	40	40	40	40
比較隨燃剂1 * 8	49.0			
比較難能剂 2 * *		46.0		
比較難燃剤 3°1°			49.5	
比較難燃剂 4°11				88.6
ノボラック 1 *4	84.8	34.8	84.3	26.2
ノボラック 2 **	84.3	34.8	84.3	26.2
溶媒**	80	80	80	80
反応触媒**	8.5	3.5	8.5	8.5
水験化アルミニウム				
水理化マグネシウム				
シリカ				
ガラス転移温度(C)	140	138	148	210
引張強度(MPa)	65	60	65	50
引養彈性率(GPa)	1.9	1.8	1.9	8.1
引張伸び(%)	5.5	3.8	4.8	0.8
難燃性	Vo	VO	VO	VO

4 R ·

27

● 9 : トリフェニルホスフェイト

**\*10:** 

+11

$$\begin{bmatrix} \bigcirc \\ \bigcirc \\ -0 \end{bmatrix}_{2}^{0} - \text{NH} - \text{N$$

# [0101]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、ハロゲンを含有しないで優れた難燃性を示し、しかも高い

ガラス転移温度を有し、機械強度に優れたエポキシ樹脂 組成物が提供される。

# フロントページの続き

Fターム(参考) 4J002 AC033 AC073 AC083 BB153

CC042 CC052 CD011 CD021

CD041 CD051 CD121 CE002

DE077 DE147 DJ017 DJ037

EW156 FD140 FD142 FD150

4J036 AB01 AB02 AB03 AB10 AC05

AD05 AD07 AD08 AF06 AG06

AJ08 AJ09 AJ11 DA10 D815

DB18 DB21 DB22 DC05 DC06

DC09 DC10 DC18 DC28 DC31

DC35 DC41 FA01 FA05 FA12

FB06 FB07 GA01 GA03 GA16

GA17 GA22 GA24 GA25 GA28

HA02 JA08 JA11

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)